

Purificateur De Gaz De Laboratoire Haute Pureté Pour Atmosphère Inerte Et Gaz De Procédé Ultra-Propres

Numéro d'article: KT-JH



Introduction

Découvrez notre purificateur de gaz de laboratoire haute pureté conçu pour la distribution continue de gaz inerte ultra-propre. Éliminant efficacement l'humidité et l'oxygène jusqu'à des niveaux inférieurs au ppm, ce système garantit une intégrité atmosphérique absolue pour les installations exigeantes de CVD, de synthèse de semi-conducteurs et de recherche métallurgique avancée.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Épitaxie pour semi-conducteurs et couches minces	Distribue du gaz vecteur argon ou azote ultra-pur directement dans les chambres CVD, PECVD et ALD pendant le traitement des plaquettes.	Évite l'oxydation du substrat, minimise les défauts de micro-trous (pinholes) et garantit une grande uniformité du film sur les couches atomiques délicates.
Traitement thermique sous atmosphère inerte	Purifie les flux de gaz de protection pour les fours tubulaires, les fours sous atmosphère sous vide et les unités de frittage dentaire traitant des alliages réactifs.	Élimine le calaminage de surface et la décarburation sur le titane, le zirconium et les suralliages réfractaires pendant les cycles à haute température.
R&D sur les batteries au lithium et à état solide	Conditionne les atmosphères protectrices à l'intérieur des boîtes à gants, des lignes d'assemblage de cellules poches et des stations de formulation d'électrolytes.	Protège les anodes en lithium métal et les formulations d'électrolytes solides sensibles à l'humidité contre toute dégradation catastrophique due à l'humidité.
Fabrication de fibres optiques et de photovoltaïque	Purifie l'atmosphère de procédé pendant l'étirage de préformes, la lingotique du silicium et le dépôt de couches de contact passivées sur les plaquettes.	Évite les bandes d'absorption hydroxyle (OH) dans le verre de silice et préserve la durée de vie des porteurs dans les cellules solaires à haut rendement.
Fabrication additive et impression 3D	Recircule et raffine les gaz de protection inertes à l'intérieur des chambres de construction de fusion sélective par laser (SLM) et de fusion par faisceau d'électrons (EBM).	Maintient des niveaux d'oxygène exceptionnellement bas pour éviter les projections, la porosité et la fragilisation lors de l'impression de métaux réactifs.
Alimentation en gaz vecteur pour instruments analytiques	Fournit des flux vecteurs ultra-stables et exempts d'humidité pour la chromatographie en phase gazeuse (GC-MS), la spectrométrie d'émission optique (OES) et l'ATG.	Réduit le bruit de fond, évite le saignement des colonnes, prolonge la durée de vie des détecteurs analytiques et améliore la reproductibilité quantitative.
Catalyse et synthèse de nanomatériaux	Fournit des atmosphères réactionnelles propres pendant la réduction des catalyseurs, la calcination et la synthèse à haute pression de nanotubes de carbone (NTC).	Élimine l'empoisonnement compétitif des sites catalytiques actifs causé par les impuretés résiduelles d'oxygène et d'humidité organique.

Paramètre de spécification	KT-JH-10	KT-JH-30	KT-JH-60	KT-JH-100
Référence de l'article	KT-JH-10	KT-JH-30	KT-JH-60	KT-JH-100
Compatibilité avec les gaz purifiés	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2
Débit nominal	10 L/min (0,6 m³/h)	30 L/min (1,8 m³/h)	60 L/min (3,6 m³/h)	100 L/min (6,0 m³/h)
Exigence de pureté du gaz d'entrée	≥ 99,99 % (Qualité technique)	≥ 99,99 % (Qualité technique)	≥ 99,99 % (Qualité technique)	≥ 99,99 % (Qualité technique)
Niveau d'impureté en sortie (O2)	≤ 0,05 ppm (≤ 50 ppb)	≤ 0,05 ppm (≤ 50 ppb)	≤ 0,05 ppm (≤ 50 ppb)	≤ 0,05 ppm (≤ 50 ppb)
Niveau d'impureté en sortie (H2O)	≤ 0,1 ppm (Point de rosée ≤ -90 °C)	≤ 0,1 ppm (Point		